## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

# (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### - 1 **6**15 (1314) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516) (1516)

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 27. Januar 2005 (27.01.2005)

PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/007286 A1

(51) Internationale Patentkiassifikation<sup>7</sup>: B01J 21/06, 35/00, 37/025, 37/34

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/051514

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. Juli 2004 (15.07.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 03102194.2 16. Juli 2003 (16.07.2003) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): PROFINE GMBH [DE/DE]; Mülheimer Strasse 26, 53840 Troisdorf (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FRINGS, Wolfgang [DE/DE]; Niederhof 10, 55606 Kirn (DE). SEPEUR, Stefan [DE/DE]; Zur Lambertstrasse 49, 66787 Wadgasssen (DE). GROSS, Frank [DE/DE]; Karlstrasse 37, 66386 St. Ingbert (DE). KRECHAN, Reimund [DE/DE]; Langwiesstrasse 11, 66646 Alsweiler (DE). WEYER, Christoph [DE/DE]; Baroniestrasse 15, 66802 Überherrn (DE).
- (74) Anwalt: HT-PATENTABTEILUNG; Zusammenschluss Nr. 200, Mülheimer Strasse 26, 53840 Troisdorf (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Identität des Erfinders (Regel 4.17 Ziffer i) für alle Bestimmungsstaaten
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für alle Bestimmungsstaaten
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17
  Ziffer iii) für alle Bestimmungsstaaten
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE COATING OF A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: PHOTOKATALYTISCH AKTIVE BESCHICHTUNG EINES SUBSTRATS

(57) Abstract: The invention relates to a photocatalytically active coating of a substrate, which is composed of a protective layer and photocatalytically active particles that are applied thereto, the protective layer having no photocatalytic activity. The protective layer preferably contains ZrO<sub>2</sub> and SiO<sub>2</sub>.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine photokatalytisch aktive Beschichtung eines Substrats, aufgebaut aus einer Schutzschicht und hierauf aufgebrachten photokatalytisch aktiven Partikeln, wobei die Schutzschicht keine photokatalytische Aktivität aufweist. Die Schutzschicht enthält bevorzugt Zr02 und Si02.

